

ICP-Spektrometer 5100 VDV

Agilent Technologies Inc., 2016

Technische Daten:

- simultanes optisches ICP-Emissionsspektrometer
- HF-Halbleitergenerator, stehende Plasmafackel
- Dual View: axiale und radiale Plasmabetrachtung für niedrige Nachweisgrenzen und breite Konzentrationsbereiche der zu analysierenden Elemente
- Echelle-Optik ohne bewegte Teile, CCD-Detektor mit Peltier-Kühlung
- HF-resistentes Probenzuführungskit
- Autosampler für hohen Probandurchsatz
- Softwaretools zur automatischen Untergrund- und Interferenzkorrektur
- Kalibration mit handelsüblichen Standardlösungen
- zusätzlich schnelle Messung mit vorkalibrierter Übersichtsmethode möglich



Forschungsaufgaben, Projekte, Veröffentlichungen:

Das ICP-Spektrometer wird vorrangig für folgende Aufgaben im Bereich der metallurgischen Analytik eingesetzt:

- quantitative Bestimmung von Legierungs-, Begleit- und Spurenelementen in Stählen nach vorherigem nasschemischen Aufschluss
- quantitative Analyse von Stahlpulvern
- quantitative Bestimmung von Legierungs-, Begleit- und Spurenelementen in anderen Metallen und in Nichtmetallen nach vorherigem nasschemischen Aufschluss